# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-213626

(43) Date of publication of application: 15.08.1997

(51)Int.CI.

H01L 21/027

G03B 27/62 G03F 7/20 H01L 21/68

(21)Application number : 08-044246

(71)Applicant: CANON INC

(22) Date of filing:

06.02.1996

(72)Inventor: CHIBA YUJI

HARA SHINICHI

## (54) ORIGINAL SHEET RETAINER AND ALIGNER USING IT

# (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To simplify and miniaturize a mask stage and a mask carrying equipment of an aligner or the like.

SOLUTION: A mask stage which positions a mask E of kinematic mount system to exposure light has a stage base 10 and a retaining frame 20, horizontally carries the mask E in a space part between the stage base 10 and the retaining frame 20, clamps the mask E with three balls 21a-21c which are unified in a body with the retaining frame 20 and clamp units 11a-11c, and fixed the mask E. Thereby carrying weight is remarkably reduced as compared with a case that a mask is carried by retaining the mask with a mask holder and fixed on a mask stage via the mask holder, and carrying equipment

.<u>1</u>886 マスクフレーム

and mechanism of a mask stage can be simplified and miniaturized.

# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

28.06.1999

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3243168

[Date of registration]

19.10.2001

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許/广 (J P)

# (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出關公園得号

特開平9-213626

(48)公開日 平成9年(1997)8月15日

(51) Int.Cl° H01L 21/027 G08B 27/62 G08F 7/20	<b>晚</b> 知起号 5 2 1	广内强迎鲁号	FI H01L 21/30 G03B 27/62 G03F 7/20	608D	技術表示個所
H01L 21/68			H01L 21/68	N	

## 事変節水 未酵水 前水束の数6 PD (全 6 頁)

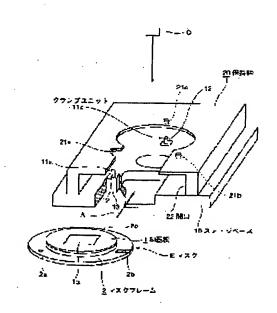
(21) 出職黨号	<b>特顯平8-44246</b>	(71) 出職人 000001007
(22) 出讀日	平成8年(1996) 2月8日	キヤノン株式会社 東京艦大田区下丸子 3 丁目90番 2 号
		(72)発明者 干集 裕司
		神奈川県川崎市中駅区今井上町53番地 キ
	•	ヤノン株式会社小杉事業所内
		(72)発明者 原 真—
	•	神承川県川崎市中駅区今井上町38番均 中
		ヤノン株式会社小杉事業所内
		(74)代型人 弁理士 版本 義明

# (54) 【発明の名称】 「原版保持数量およびこれを用いた象光数量

## (57) [要約]

【課題】 露光装置等のマスクステージやマスク推送装置を簡単化かつ小形化する。

【解決手段】 露光光に対してキネマティックマウント方式のマスクEを位置決めするマスクステージは、ステージベース10と保持枠20を有し、両者の間の空間部にマスクEを水平に搬入し、保持枠20と一体である3個のボール21e~21cとクランプユニット11e~11cによってマスクEをクランプして固定する。マスクをマスクホルダに保持させて搬入し、これを介してマスクステージに固定する場合に比べて搬送重量が大幅に低減され、搬送装置やマスクステージの機械も開除化かつ小形化できる。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 ステージベースと、該ステージベースとの間に原版収容空間を形成する筐体と、該筐体の前記原版収容空間に搬入された原版をこれに重直なクランプカによってクランプするクランプ手段を有し、前記筐体

が、前記原版を前記原版収容空間の側傍からこれに触入 するための開口部を有することを特徴とする原版保持装 置。

【請求項2】 筐体が、原版を原版収容空間から挽出するための第2の開口部を有することを特徴とする請求項1記載の原版保持装置。

【請求項3】 原版がキネマティックマウント方式のマスクであり、クランプ手段が、ステージベースと筐体にそれぞれ配設された3個のクランプユニットと3個のボールを有することを特数とする請求項1または2記載の原版保持経営。

【請求項4】 請求項1ないし3いずれか1項記載の原版保持装置と、これに保持された原版を適して照射される爾光光によって基板を露光する露光手段を有する露光 装置。

【請求項 5】 露光光がX線であることを特徴とする諸 球弾明記戦却蘇跳襲置。

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体酶光装置や E B描画装置あるいはパターン寸法測定機等において磁 石や英空チャック等を用いることなくマスク等原版を安 定保持できる原版保持装置およびこれを用いた露光装置 に関するものである。

[0005]

【従来の技術】×線等を露光光とする微細化の進んだ半 導体露光装置のマスク等原版は、一般的に、図6の

【0003】なお、マスクのパターンPを形成する工程 あるいはマスクの製作を完了した後にパターン寸法を測 定する工程等においては、電子ビームを使用するために 永久砥石や電磁石を用いたマスクチャックを使用することができず、公知の真空吸着装置やパネクランプ等を用いてマスクを固定する。

【0004】ところが、このように真空吸毒装置やパネクランプを用いてマスクを固定すると、磁石または電磁石によって露光装置のマスクステージに固定した場合と異なる至が発生してマスクのパターンが大きく変形する。

【0005】そこで、この問題を解決するために、図5に示すように、マスクをこれに乗直に作用する3個のクランプカFa~Foによってクランプするいわゆるキネマティックマスクが開発された。

【0006】これは、マスク100のマスクフレーム1 O2の裏面(または表面)に3個のボールBe~Bcを 当てがい、ボールBe~Boに向かってそれぞれ図示し ないクランプ部材を接近させて、各ポールBe~Bcと クランプ部材の間にマスク100のマスクフレーム10 2をクランプするもので、クランプカFa~Fcによっ てそれぞれマスク100の垂直方向(2軸方向)の位置 を固定するとともに、第1のボールBbをマスクフレー ム102の表面に設けられた円錐溝1028に係合させ ることでこの部分のみをと軸に垂直なXY平面内で固定 し、第2のボールBeを円錐溝102aに対して放射状 にのびるV形満 1 D2 bに摺動自在に係合させることで その回転位置を固定する。 なお、第3のボール Bcはマ スクフレーム102の裏面の平坦部に当接されて任意の 方向に転動自在であり、マスク100を不必要に拘束す ることのないように構成される。

【0007】すなわち、3個のボールBe〜Bcによってそれぞれ作用するクランプカFe〜Fcのみを利用して、マスク100のX,Y,Z軸と、ωX,ωY,ωZ軸の合計 6軸方向の位置決めを行なうように構成されており、このようなキネマティックマスクは、マスクに不必要な拘束力を与えることなく安定保持できるうえに、磁力や真空吸着力を必要としないために締光装置、EB描画装置およびパータン検査機等のマスク保持装置をすべて同一様成にして、マスクの珍し変えによる転零パターンの変形を防ぐことができる。従って、高精度のX線露光装置等に好適である。

【0008】図4は、露光装置等においてキネマティックマスクを保持するマスクステージ210を示すもので、前記マスク100と同様のマスク200はクランプがけ221e~221cとボール222を有するマスクホルダ220に保持されてマスクステージ210に搬送され、マスクホルダ220をマスクステージ210に保持部が211に固定することでマスク200位置決めが行なわれる。マスク200はマスクフレーム200の表面側に円錐溝202eとV形溝202bを有し、マスクホルダ220は、マスクフレーム220の円錐溝202eとV形溝202bと所定の平坦面をそれぞれ、マ

・スクボルダ220から下向きに突出する3個のボール2 22とクランプ部材2218~221cの間に挟持する。

【0009】このように、キネマティックマウント方式 によってマスク200を保持するマスクホルダ220を 銀送ハンド等によって把持してマスクステージ210に 銀送し、マスクホルダ220をマスクステージ210に 固定することで、露光光学系等に対するマスク200の 位置決めが行なわれる。

### [0010]

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら上記従来の技術によれば、前述のように、マスクをキネマティックマウント方式によってマスクホルダに保持させて搬送し、マスクホルダを介してマスクステージ上にマスクを固定するものであるため、露光装置等にマスクを供給する工程が頻2である。加えて、マスクホルダにはマスクを安定保持するための高い別性が要求され、従って一般的にマスクホルダが高重量となり、その結果、マスクを搬送するときの搬送量量が増大し、搬送装置も大掛かりになるという未解決の課題があった。

【〇〇 1 1】本発明は、上記従来の技術の有する未解決の課題に鑑みてなされたものであり、高重量のマスクホルダ等を必要とすることなく、キネマティックマウント方式等によって直接マスク等原版を安定保持できる原版保持装置およびこれを用いた露光装置を提供することを目的とするものである。

## [0012]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本発明の原版保持装置は、ステージペースと、該ステージペースとの間に原版収容空間を形成する筐体と、、該筐体の前記原版収容空間に搬入された原版をされに垂直なクランプ力によってクランプするクランプ手段を有し、前記筐体が、前記原版を前記原版収容空間の側傍から、前に搬入するための開口部を有することを特徴とする

【0013】筐体が、原版を原版収容空間から推出するための第2の開口部を有するとよい。

【0014】原版がキネマティックマウント方式のマスクであり、クランプ手段が、ステージベースと健体にそれぞれ配設された3個のクランプユニットと3個のボールを有するとよい。

## [0015]

【作用】ステージベースと筐体の間に形成された原版収容空間にマスク等の原版を直接搬入してクランフするものであるため、高重量のマスクホルダ等に原版を収容した状態でステージベース等に搬送する場合に比べて搬送重量が低減され、その結果、搬送装置等を大幅に簡単化および小形化できる。

【0016】また、マスクホルダ等に原版を収容しこれ をクランプする動作が不要となるため、原版の交換作業 等が輸<mark>時化され、露光</mark>装置等のスループットを大きく向 上できる。

【0017】さらに、マスクホルダ等を介在させる場合 に比べて、原版を保持した状態の原版保持装置の機構が 大幅に簡略化され、その高さ方向の寸法も縮小できる。 これによって、露光装置全体の機構の簡単化と小形化に 大きく質載できる。

【0018】 筐体が、原版を原版収容空間から搬出するための第2の開口部を有すれば、第2の開口部から使用済みの原版を搬出するとほぼ同時に第1の開口部から新たな原版を搬入できるため、原版の交換時間を大幅に短節できる。これによって、露光装置等のスループットを大幅に向上できる。

### [0019]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。

【0020】図1は第1実施例による原版保持装置を示すもので、これは、露光手段である光源0から発生される×線等の露光光によって基板であるウエハを露光する露光装置のマスクステージであり、クランプ手段である3個のクランプユニット11e~11e~21e~21eを備えた性体である保持枠20を有する。

【ロロ21】ステージペース10と保持枠20の間には キネマティックマウント方式の原版であるマスク目を収 容するのに充分な原版収容空間である空間部が形成さ れ、また、保持枠20の一側面には前記空間部に対して マスク目を矢印Aで示す方向に搬入し、これと逆の方向 に搬出するための関口部である関口22が形成されてい る。

【0022】マスクEは、中央の開口部に図示しないパターンを有するメンブレン1 a を支持するSi基板1と、その外周部を保持するマスクフレーム2を有し、マスクフレーム2の図示上面には、前記マスクホルダ21 a~21cをそれぞれ当接自在である円錐海2 a とV形済2 b と平坦面2 c が設けられている。

【0023】各クランプユニット118~116は、前述のようにステージベース10に支持され、ステージベース10に支持され、ステージベース10と保持枠20の間の空間部に突出するクランプ部材12と、これを上下動させるための駆動部(エアーシリンダ)13を備えており、クランプ部材12を保持枠20の各ポール218~21cに向かって通過させることで、マスクEのクランプ動作およびクランプ解除を行なうように構成されている。

【0024】マスクステージに対するマスクEの搬入および装着(位置決め)は以下のように行なわれる。図2に示すように、マスクEのマスクフレーム2を搬送ハンドNによって把持し、保持枠20の開口22を経てステ

ージベース10と保持枠20の間の空間部へ挿入し、マスクEのマスクフレーム2の円維講2eとV形講2bと平坦面2cをそれぞれボール21e~21cの面下に立させる。 続いて、各クランプユニット11e~11cの駆動部13を駆動してクランプ部材12を上昇させ、おボール21e~21cとの間に垂直に作用するクランプカによってマスクフレーム2を直接マスクラよってマスクラレーム2を直接マステージに固定する。 また、マスクEをマスクステージに固定する。 また、マスクEをマスクステージ いの駆動部13を逆駆動してクランプユニット12を下の駆動部13を逆駆動してクランプユニット12を下降させたうえで、矢印Aと逆向きにマスクEを搬出することによって行なわれる。

【0025】本実施例によれば、マスクのマスクフレームを直接推進ハンド等によって把持してマスクステージに推進し、そのままマスクステージの保持枠の開口からステージペースと保持枠の間にスライドさせたうえでもクランブユニットを駆動し、これらによってクランプするものであり、従来例のようなマスクホルダを必要としない。従って、マスクをマスクホルダに保持させる作業が簡単化されるうえに、マスクを高重量のマスクホルダとともに推進する場合に比べて推進重量を低減し、推送装置を大幅に簡単化かつ小形化できる。

【 0025】さらに、マスクホルダを介してマスクステージにマスクを装着する場合に比べて、マスクステージ に装着したときのマスクの高さを低減できるとともにマスクの落下による破損を防止するという利点を有し、また、マスクの表面側にV形満や円錐溝を設けて各クランブユニットを保持枠側に配置すれば、より一層マスクの高さを低減できる。

【0027】このような原版保持装置をマスクステージ に用いることで、X線を露光光とする露光装置等の簡単 化および小形化に大きく貢献できる。

【ロロ28】なお、各クランブユニットの駆動部にはエアーシリンダに限らず、他の復動型のアクチュエータを用いることもできる。

【0029】図3は第2実施例による原版保持装置であるマスクステージを示すもので、これは、第1実施例の保持枠20と同様の保持枠30の第1の開口32eの反対側にマスクEを保持枠30の内部から搬出するための第2の開口部である開口32bを設けたものである。マスクE、ステージベース10、クランプユニット11e~11c、ボール21e~21c等については第1実施

例と同様であるから同一符号で表わし、説明は省略する。矢印A1 で示すように第1の開口32 aからステージベース10と保持枠30の間の空間部にマスクEを搬入し、矢印A2 で示すように第2の開口32 bから搬出する。

【0030】マスクの推入と推出を同方向にほぼ同時に 行なうことができるため、マスクの交換作業を高速化で きるという利点が付加される。その他の点は第1実施例 と同様である。

### [0031]

【発明の効果】本発明は上述のとおり構成されているので、次に記載するような効果を突する。

【0032】高重量のマスクホルダ等を介在させることなく、キネマティックマウント方式等によって直接マスク等原版を露光装置のマスクステージ等に安定して固定できる。

【0033】これによって、露光装置のマスク推送装置等を大幅に簡単化かつ小形化し、また、マスク交換作業等を開略化してスループットを向上できる。加えて、マスク等の推入、提出作業をほぼ同時に行なうことで交換時間を短縮することも参見である。さらに、マスク等を保持した状態のマスクステージ等の機構が簡略化され、その高さ方向の寸法も大幅に整小してマスクの落下による破損を防ぐことができる。その結果、露光装置全体の機構の簡単化と小形化に大きく貢献できる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】第1実施例によるマスクステージを一部分破断 した状態でマスクとともに示す一部破断斜視図である。 【図2】図1の装置にマスクを装着した状態を示す一部 破断斜視図である。

【図3】第2実施例によるマスクステージとマスクを示す斜視図である。

【図4】従来例を説明する説明図である。

【図5】キネマティックマウント方式のマスクを説明する図である。

【図5】マスクの製造工程を説明する図である。 【符号の説明】

1 Si 基板

2 マスクフレーム

10 ステージベース

116~110 クランプユニット

20,30 保持枠

21e~21c ボール

22, 32e, 32b 開口

